

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

# PATENTCHRIFT



(12) Wirtschaftspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

(19) DD (11) 224 448 A1

4(51) H 01 L 21/30  
G 03 B 27/32  
G 03 B 27/68

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

---

|      |                       |      |          |      |          |
|------|-----------------------|------|----------|------|----------|
| (21) | WP H 01 L / 260 460 6 | (22) | 01.03.84 | (44) | 03.07.85 |
|------|-----------------------|------|----------|------|----------|

---

|      |  |
|------|--|
| (71) | VEB Carl Zeiss JENA, 6900 Jena, Carl-Zeiss-Straße 1, DD                      |
| (72) | Hesse, Rainer, Dipl.-Ing.; Gärtner, Wolfgang, Dr.-Ing.; Kuch, Karl-Heinz, DD |

---

(54) Einrichtung zur fotolithografischen Strukturübertragung

---

(57) Es wird eine Einrichtung zur fotolithografischen Strukturübertragung mittels eines Projektionsobjektivs beschrieben. Sie ist zur Erzeugung von Halbleiterstrukturen in einer fotoempfindlichen Schicht einer Halbleiterscheibe nach der Planartechnologie anwendbar. Das Ziel der Erfindung besteht in der Erhöhung der Genauigkeit bei hoher Produktivität der Strukturübertragung. Als Aufgabe steht die Schaffung einer Einrichtung, die bei Verwendung einer Immersionsflüssigkeit Turbulenzen vermeidet und mögliche Verunreinigungen außerhalb des Schärfentiefebereiches des Projektionsobjektivs hält. Die Erfindung besteht darin, daß zwei mit Immersionsflüssigkeit gefüllte Kammern vorgesehen sind, von denen eine dem Projektionsobjektiv und die zweite dem Substrat zugeordnet sind. Höchste Auflösung wird erreicht, wenn zwischen den die Kammern abschließenden optisch transparenten Medien ebenfalls Immersionsflüssigkeit eingebracht wird. Fig. 1

ISSN 0433-6461

11 Seiten

Titel der Erfindung

Einrichtung zur fotolithografischen Strukturübertragung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur fotolithografischen Strukturübertragung mittels eines Projektionsobjektivs zum Erzeugen eines Belichtungsmusters in einer fotoempfindlichen Schicht eines Substrates. Sie ist insbesondere bei der Erzeugung einer Mikrostruktur in einer fotoempfindlichen Schicht einer Halbleiterscheibe zur Herstellung von Halbleiterstrukturen nach der Planartechnologie anwendbar.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

In der veröffentlichten Europäischen Patentanmeldung EP 0 023 231 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Kopieren eines Musters auf eine Halbleiterscheibe beschrieben, die zwischen einem Projektionsobjektiv und einer Halbleiterplatte eine Flüssigkeit verwendet, deren Brechungsindex dem des Lacküberzuges der Halbleiterplatte entspricht. Dabei wird die Flüssigkeit ständig ausgetauscht und temperiert und/oder gefiltert. Diese Vorrichtung soll eine Vergrößerung der numerischen Apertur ohne Vergrößerung des Einfallswinkels ermöglichen. Dieses auch aus der Mikroskopie bekannte Prinzip (man vergleiche hierzu: Brockhaus, "ABC der Optik" Brockhaus Verlag Leipzig, 1961 S. 565 ff.) ist bei Übertragung auf das Gebiet der Mikro-

lithografie mit Nachteilen behaftet. Ein Nachteil besteht darin, daß in der Flüssigkeit, deren Volumen bei dem beschriebenen Verfahren erheblich ist, zwischen Projektionsobjektiv und Halbleiterscheibe bei der Herstellung von hochintegrierten Schaltkreisen infolge der notwendigen Verfahrensbewegung der auf einem Koordinatentisch befindlichen Halbleiterscheibe Turbulenzen erzeugt werden. Deshalb wird man, bei heute aus Produktivitätsgründen hohen Verfahrensgeschwindigkeiten, entweder Fehler bei der Strukturübertragung in Kauf nehmen müssen oder man muß das Zeitregime für jeden Belichtungsschritt, um die Zeit für die Beruhigung der Turbulenzen erweitern, was wiederum Produktivitätseinbußen bedeutet.

Ein weiterer Nachteil ist die Handhabbarkeit des zu belichtenden Substrates unter Cleanroom-Bedingungen. Bei dem Verfahren gemäß obengenannter Patentanmeldung muß nach jeder vollständigen Belichtung einer Halbleiterscheibe diese aus der Flüssigkeit herausgebracht werden und von der Flüssigkeit getrennt werden. Hier besteht zunächst die Gefahr, daß zum Beispiel Staub oder andere unerwünschte Stoffe die Oberfläche des Substrates belegen. Desweiteren läßt sich die Oberfläche des Substrates zum Beispiel zur Vorbereitung auf einen Kontrollschritt infolge der zahlreichen Stufen, Gräben, Erhöhungen etc. nur mit hohem Aufwand von der Flüssigkeit befreien. Weiterhin nachteilig ist die Verwendung eines nach oben offenen Behälters, der die Flüssigkeit beinhaltet. Die daraus resultierende große Flüssigkeitsoberfläche bietet so Eintrittsmöglichkeiten für Verunreinigungen der Flüssigkeit, die erst nach Durchlauf eines Filters beseitigt werden können.

#### Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist die Schaffung einer hochproduktiven und hochgenauen Einrichtung zur fotolithografischen Strukturübertragung.

### Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zur fotolithografischen Strukturübertragung mittels eines Projektionsobjektivs zu entwickeln, in welcher ein geringes Volumen Immersionsflüssigkeit Verwendung findet, so daß keine störenden Turbulenzen in Erscheinung treten und die so aufgebaut ist, daß mögliche Verunreinigungen außerhalb des Schärfentiefebereiches des Projektionsobjektivs liegen und so keine Strukturierungsfehler verursachen. Das zu belichtende Substrat soll so handhabbar sein, daß die fotoempfindliche Schicht des Substrats in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß bei einer Einrichtung zur fotolithografischen Strukturübertragung mittels eines Projektionsobjektivs zum Erzeugen eines Belichtungsmusters in einer fotoempfindlichen Schicht eines parallel zur Bildebene schrittweise bewegten und auswechselbaren Substrats, wobei im optischen Strahlengang zwischen der fotoempfindlichen Schicht und der dieser zugewandten Grenzfläche des Projektionsobjektivs eine Immersionsflüssigkeit annähernd gleichen Brechwertes wie der der lichtempfindlichen Schicht Verwendung findet, im optischen Strahlengang zwischen Projektionsobjektiv und der fotoempfindlichen Schicht des Substrats zwei voneinander getrennte, gegen die Atmosphäre abgeschlossene, relativ zueinander bewegbare und mit Immersionsflüssigkeit gefüllte Kammern vorgesehen sind, wobei die erste Kammer, die mit dem Projektionsobjektiv fest verbunden ist, von der der fotoempfindlichen Schicht zugewandten Grenzfläche des Projektionsobjektivs und von einem optisch transparenten Medium begrenzt wird, und die zweite Kammer, die mit dem Substrat verbunden ist, von der fotoempfindlichen Schicht des Substrats und von einem weiteren optisch transparenten Medium begrenzt wird.

Als optisch transparente Medien lassen sich vorteilhaft Glasplatten und/oder Folien einsetzen.

Zur Verringerung des Volumens an bewegter Immersionsflüssigkeit und damit zur Verringerung von Turbulenzen in der Immersionsflüssigkeit ist es von Vorteil, wenn mindestens eine Kammer mit einer Einrichtung zur Veränderung des Druckes der Immersionsflüssigkeit in Verbindung steht und wenn das optisch transparente Medium dieser Kammer senkrecht zur Bildebene bewegbar angeordnet ist.

Zur weiteren Erhöhung der Auflösung des Projektionsobjektivs sowie zur Verringerung von Strukturübertragungsfehlern kann man zwischen den die Kammern begrenzenden optisch transparenten Medien ebenfalls Immersionsflüssigkeit einbringen.

#### Ausführungsbeispiele

In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt, und zwar zeigen:

- Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Einrichtung mit zwei Glasplatten als Abschluß der Kammern,
- Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel mit einer mittels Ringmembran bewegbar angeordneten Glasplatte,
- Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel, wo die Kammer vor dem Projektionsobjektiv mit einer Folie abgeschlossen ist.

Die erfindungsgemäße Einrichtung besteht nach Fig. 1 aus einem gestellfesten Projektionsobjektiv 1. Mit dem Projektionsobjektiv 1 fest verbunden ist eine Kammer 2, die restlos mit Immersionsflüssigkeit 3 gefüllt ist. Die Kammer 2 ist gegen die Atmosphäre abgeschlossen und wird im optischen Strahlengang von der der fotoempfindlichen Schicht zugewandten Grenzfläche 4 des Projektionsobjektivs 1 und von einer optisch transparenten, planparallelen Glasplatte 5 begrenzt. Desweiteren besteht die

Einrichtung aus einer zweiten Kammer 6, die mit dem zu belichtenden Substrat zum Beispiel mit einer Halbleiterscheibe 7 verbunden ist. Diese zweite Kammer 6 wird unter anderem von der fotoempfindlichen Schicht 8 der Halbleiterscheibe 7 und von einer weiteren optisch transparenten, planparallelen Glasplatte 9 begrenzt. In der zweiten Kammer 6 befindet sich ebenfalls Immersionsflüssigkeit 10. Die zweite Kammer 6 einschließlich der Glasplatte 9 und der Halbleiterscheibe 7 befinden sich auf der Tischplatte 11 eines Koordinatentisches, der über Bewegungseinrichtungen 12 eine Relativbewegung der Halbleiterscheibe 7 parallel und senkrecht zur Bildebene 13 bewirkt.

Zur Erhöhung der Auflösung befindet sich zwischen den beiden die Kammern 2, 6 begrenzenden Glasplatten 5 und 9 weitere Immersionsflüssigkeit 14, deren Oberfläche 15 in einem Behälter 16 höher liegt, als die der Halbleiterscheibe zugewandte Fläche 17 der Glasplatte 5. Zwischen der Grenzfläche 4 des Projektionsobjektivs 1 und der fotoempfindlichen Schicht 8 der Halbleiterscheibe 7 verläuft der optische Strahlengang somit nur in Medien annähernd gleichen Brechwertes wie der der fotoempfindlichen Schicht, wenn man voraussetzt, daß die Brechwerte der Immersionsflüssigkeiten 3, 10 und 14 und der Glasplatten 5 und 9 annähernd übereinstimmen. Will man eine weitere Reduzierung des bewegten Volumens an Immersionsflüssigkeit 14 erreichen, das heißt auch eine Reduzierung der darin auftretenden Turbulenzen, dann kann man den Abstand zwischen den beiden zueinander bewegten Kammern 2 und 6 minimal auslegen. -Vorteilhaft lassen sich hier zum Beispiel an Kammer 2, wie in Figur 2, Glasplatten 18 einsetzen, die in der Kammer 2 mittels einer Ringmembran senkrecht zur Bildebene 13 beweglich angeordnet ist. Den gleichen Zweck soll die Folie 20 in Figur 3 erfüllen. Die Kammer 2 steht in diesen Fällen über einem Anschlußstutzen 21 mit einer

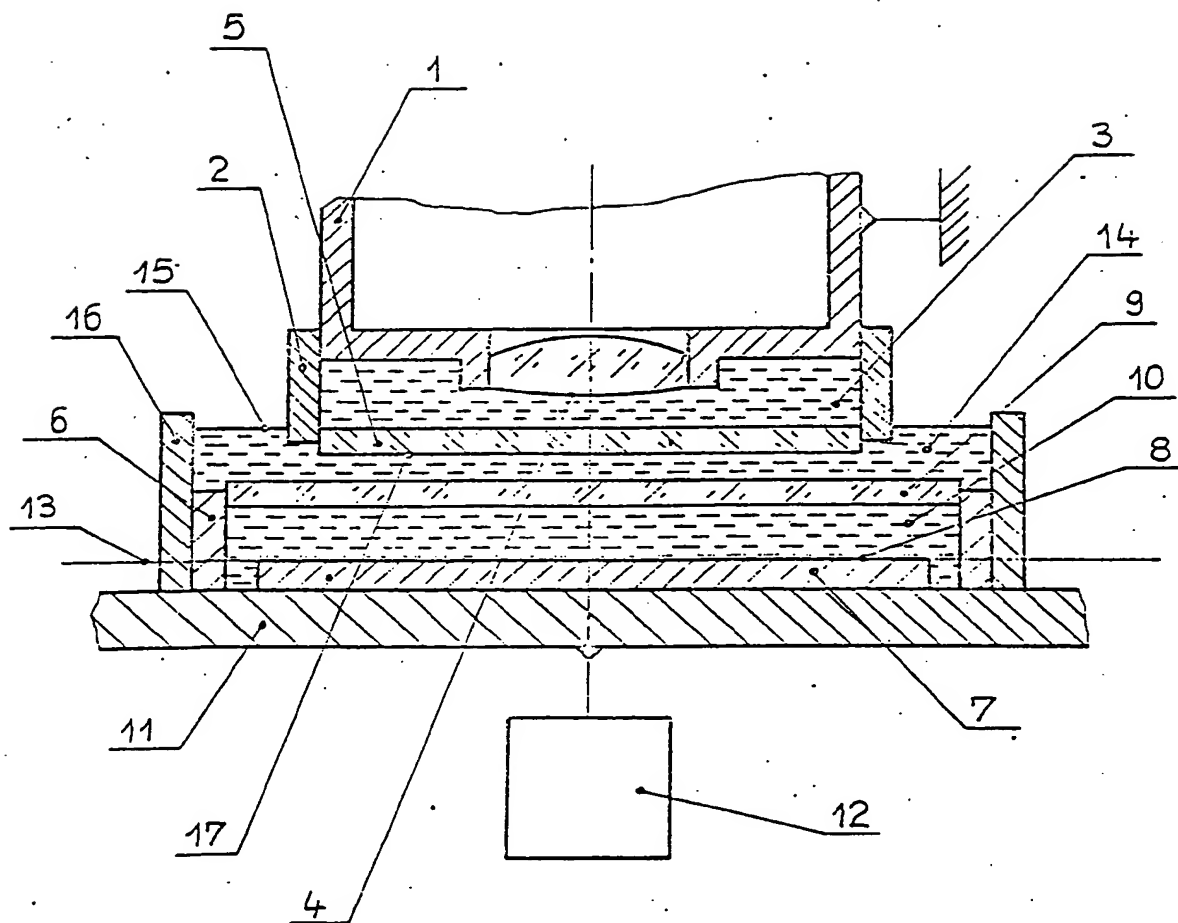
Einrichtung 22 zur Veränderung des Druckes der Immersionsflüssigkeit in Verbindung. Während der Belichtung der fotoempfindlichen Schicht 8 wird die Glasplatte 18 durch einen erhöhten Druck in der Kammer 2 in Richtung Bildebene 13 bewegt. Während der Bewegung der Tischplatte 11 zur Vermeidung von Beschädigungen der Glasplatte 18 oder Folie 20 wird durch Druckminderung der Immersionsflüssigkeit 3 in Kammer 2 die Glasplatte 18 oder Folie 20 von der sich bewegenden Glasplatte 9 wegbewegt.

Die im Ausführungsbeispiel beschriebene Einrichtung läßt sich auch ohne Immersionsflüssigkeit 14 beschreiben. In diesem Falle hätte man mit keinerlei Turbulenzen zu rechnen. Die Vorteile der erfindungsgemäßen Einrichtung bleiben erhalten, weil der Abstand beider Kammern 2 und 6 minimal gehalten werden kann und die gegen Verunreinigungen (Staub u.a.) empfindlichen Flächen außerhalb des Schärfentiefenbereichs des Projektionsobjektivs 7 liegen.

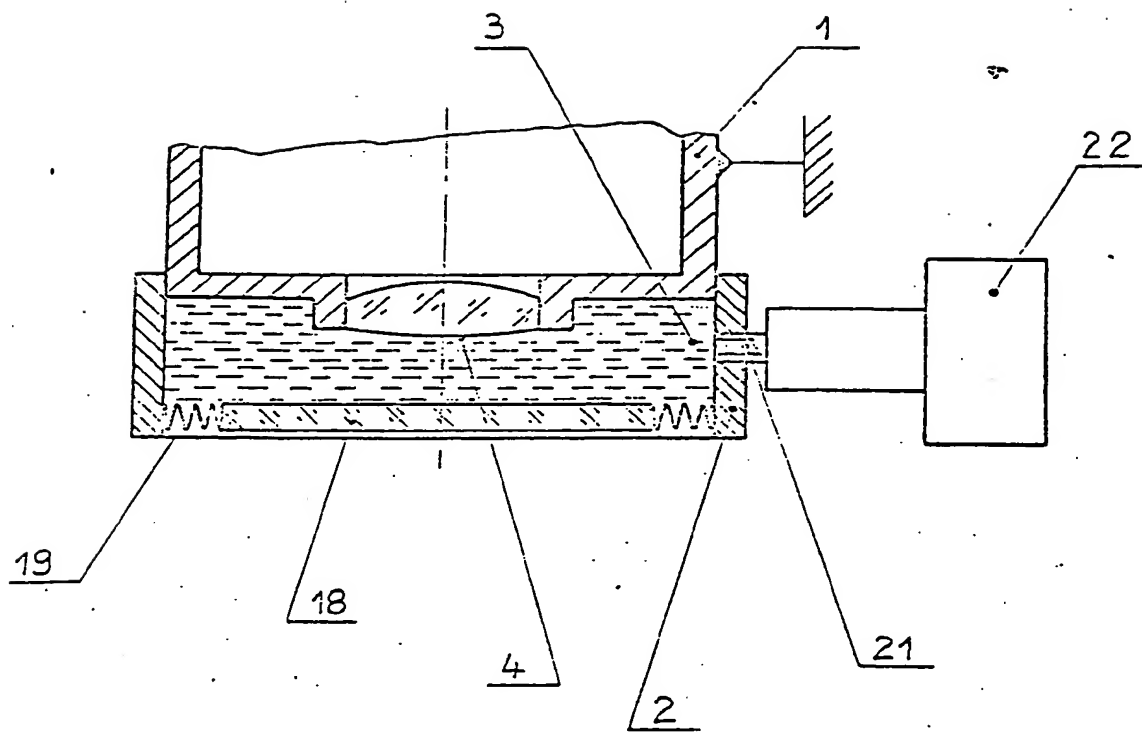
### Erfindungsanspruch

1. Einrichtung zur fotolithografischen Strukturübertragung mittels eines Projektionsobjektivs zum Erzeugen eines Belichtungsmusters in einer fotoempfindlichen Schicht eines parallel zur Bildebene schrittweise bewegten und auswechselbaren Substrats, wobei im optischen Strahlengang zwischen der fotoempfindlichen Schicht und der dieser zugewandten Grenzfläche des Projektionsobjektivs eine Immersionsflüssigkeit annähernd gleichen Brechwertes wie der der lichtempfindlichen Schicht Verwendung findet, dadurch gekennzeichnet, daß im optischen Strahlengang zwischen Projektionsobjektiv und der fotoempfindlichen Schicht des Substrats zwei voneinander getrennte, gegen die Atmosphäre abgeschlossene, relativ zueinander bewegbare und mit Immersionsflüssigkeit gefüllte Kammern vorgesehen sind, wobei die erste Kammer, die mit dem Projektionsobjektiv fest verbunden ist, von der der fotoempfindlichen Schicht zugewandten Grenzfläche des Projektionsobjektivs und von einem optisch transparenten Medium begrenzt wird und die zweite Kammer, die mit dem Substrat verbunden ist, von der fotoempfindlichen Schicht des Substrats und von einem weiteren optisch transparenten Medium begrenzt wird.
2. Einrichtung nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optisch transparenten Medien Glasplatten und/oder Folien sind.
3. Einrichtung nach Punkt 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Kammer mit einer Einrichtung zur Veränderung des Druckes der Immersionsflüssigkeit in Verbindung steht, und daß das optisch transparente Medium dieser Kammer senkrecht zur Bildebene bewegbar angeordnet ist.
4. Einrichtung nach Punkt 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich zwischen den die Kammern begrenzenden optisch transparenten Medien ebenfalls Immersionsflüssigkeit befindet.

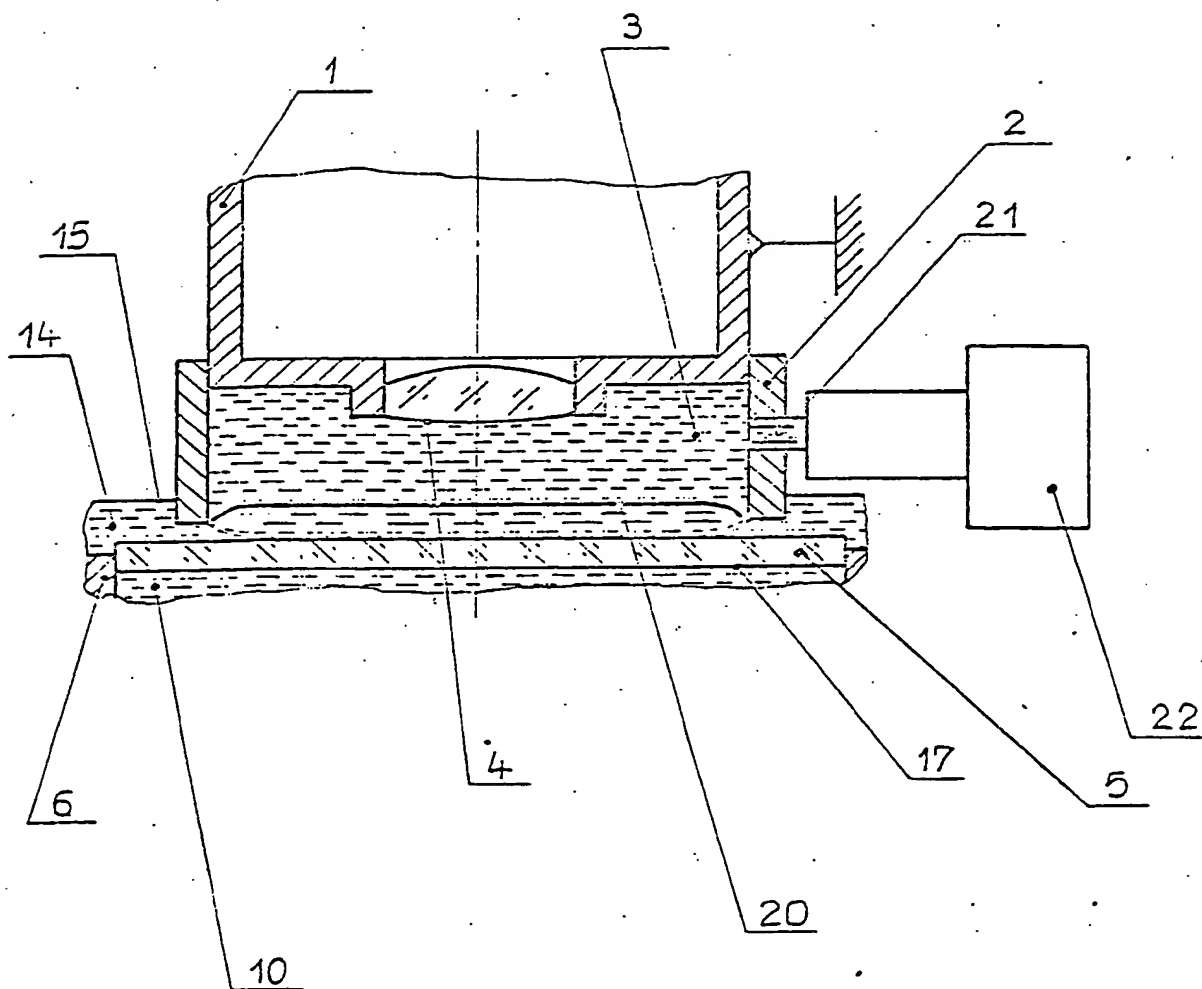




Figur 1



Figur 2



Figur 3



(12) Provisional Economic Patent

(19) DD

(11)

224 448 A1

Granted pursuant § 17 paragraph 1 Patent Act

4(51) H01 L 21/30

G 03 B 27/32

G 03 B 27/68

OFFICE FOR INVENTIONS AND PATENTS

Disclosed in the form of the version filed by the applicant

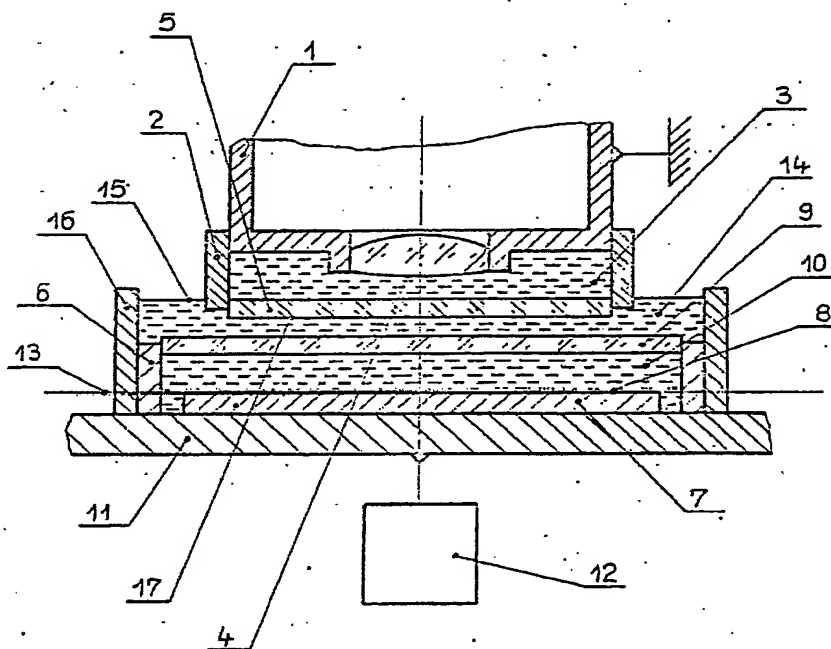
|      |                       |      |                        |      |                             |
|------|-----------------------|------|------------------------|------|-----------------------------|
| (21) | WP H 01 L / 260 460 6 | (22) | 01.03.84 (filing date) | (44) | 03.07.85 (publication date) |
|------|-----------------------|------|------------------------|------|-----------------------------|

(71) VEB Carl Zeiss JENA, 6900 Jena, Carl-Zeiss-Straße 1, DD

(72) Hesse, Rainer, Dipl.-Ing.; Gärtner, Wolfgang, Dr.-Ing.; Kuch, Karl-Heinz, DD

(54) Apparatus for the photo-lithographic transfer of structures

(57) An apparatus for the photo-lithographic transfer of structures by means of a projection objective 1 (projection lens) is described. It is used for the production of semiconductor structures in a photo-sensitive layer 8 on a semiconductor disc 7 (wafer) using planar technology. The object of the invention is to increase the accuracy with a higher productivity of structure transfer, by providing an apparatus that, when using immersion liquid, avoids turbulence and keeps possible contamination outside the Depth-Of-Focus of the projection lens 1. The invention comprises two chambers 2,6 filled with an immersion liquid 3,10, one of which 2 is associated with the projection lens 1 and the second 10 is associated with the substrate 7. The highest resolution is achieved when immersion liquid 14 is also introduced between the optically transparent media 5,9 used to seal the chambers 2,10.



Figur 1

Title of the Invention

Apparatus for the photo-lithographic transfer of structures

Field of Use of the Invention

The invention relates to an apparatus for the photo-lithographic transfer of structures by means of a projection objective (projection lens) to produce an exposure pattern in a photo-sensitive layer of a substrate. It is especially useful for the production of micro-structures in a photo-sensitive layer of a semiconductor disc (wafer) in the manufacture of semiconductor structures using planar technology.

Characteristics of known technical solutions (prior art)

The published European application EP 0 023 231 describes a method and an apparatus for copying a pattern onto a semiconductor wafer which uses, between a projection lens and a semiconductor plate, a liquid whose refractive index corresponds to that of the coating (resist) on the semiconductor wafer. Additionally, the liquid is constantly replaced and brought to the predetermined temperature and/or filtered. This apparatus allows the numerical aperture to be increased without increasing the incidence angles. This principle, also known in the field of microscopy (compare: Brockhaus, "ABC der Optik" (ABC of Optics) Brockhaus Publishing Leipzig, 1961 p. 565 ff.), proves disadvantageous when applied in the field of micro-lithography.

In the disclosed method, the volume of liquid is considerable. One of the disadvantages is the turbulences produced in the liquid between the projection lens and the semiconductor wafer during the production of highly-integrated circuits due to the necessary movements of the semiconductor wafer on a coordinate table (stage). For this reason, current high process speeds aimed at increasing productivity means that either errors in the structure transfer must be accepted or the timing schedule for each exposure step must be expanded to allow the turbulences to die down - both of which result in productivity losses.

A further disadvantage is the difficulty in handling, under cleanroom conditions, of the substrate to be exposed. Using the method of the patent application mentioned above, a wafer must be brought out of the liquid and separated from the liquid after each completed exposure. To begin with, there is a danger that, for example dust or other undesired materials may be present on the surface of the substrates. Further more, the surface of the substrates may need to be cleared of liquid before measurement or inspection can take place. This can only be done at high cost because of the numerous steps, trenches, elevations etc. on said surface. A still further disadvantage is the use of an open-topped container to contain the liquid. The resulting large surface area of liquid provides a path for contaminants to the liquid which can be removed by first passing the liquid through a filter.

#### Object of the Invention

The object of the invention is to provide a highly productive and highly accurate apparatus for photo-lithographic pattern transfer.

### The Essence of the Invention

The invention solves the problem of how to design an apparatus for photo-lithographic pattern transfer by means of a projection lens, in which a small volume of immersion liquid is used, so that no disruptive turbulences arise and is so configured that possible contaminants lie outside the Depth-Of-Focus of the projection lens and thus cause no patterning errors. Also the substrate handling should be configured to avoid compromising the photo-sensitive layer on the substrates.

According to the invention, the problem is solved by an apparatus for photo-lithographic structure transfer by means of a projection lens to produce an exposure pattern in a photo-sensitive layer on a substrate, wherein the substrate is movable in steps parallel to the image plane and wherein the substrate is exchangeable, whereby an immersion liquid with a refractive index approximately equal to that of the photo-sensitive layer is disposed in the optical path between the photo-sensitive layer and the projection lens interface facing said layer, the apparatus further comprising two chambers separated from each other and movable with respect to each other, sealed from the atmosphere and filled with immersion liquid, wherein the chambers are disposed in the optical path between the projection lens and the photo-sensitive layer of the substrate, whereby the first chamber, which is rigidly attached to the projection lens, is bounded by the projection lens interface facing the photosensitive layer and by an optically transparent medium, and whereby the second chamber, which is rigidly attached to the substrate, is bounded by the photo-sensitive layer on the substrate and by a further optically transparent medium.

Glass plates and/or films may be advantageous as optically transparent media.

In order to reduce the volume of moving immersion liquid and thus reduce turbulences in the immersion liquid, it is advantageous when at least one chamber is provided with a device for changing the pressure of the immersion liquid, and when the optically transparent medium of at least one chamber is movable perpendicular to the image plane.

To further increase the resolution of the projection lens as well as to reduce structure transfer errors, immersion liquid may also be disposed between the optically transparent media which bound the chambers.

#### Exemplary embodiments

The drawings depict exemplary embodiments, namely:

- Fig. 1 an apparatus according to the invention comprising two glass plates for sealing the chambers,
- Fig. 2 an embodiment in which a glass plate is configured to be movable using an annular membrane,
- Fig. 3 an embodiment in which the chamber in front of the projection lens is sealed with a film.

The apparatus according to the invention as depicted in Fig. 1 consists of a projection lens 1 rigidly attached to a frame. A chamber 2 is rigidly attached to said projection lens 1, and filled completely with immersion liquid 3. The chamber 2 is sealed from the atmosphere, disposed in the optical path and bounded by projection lens interface 4 facing the photo-sensitive layer 8 and by an optically transparent plane parallel glass plate 5.



The apparatus further comprises a second chamber 6, attached to the substrate for exposure, for example to a semiconductor wafer. This second chamber 6 is bound by at least the photo-sensitive layer 8, the semiconductor wafer 7 and a further optically transparent plane parallel glass plate 9. Immersion liquid 10 is also present in the second chamber 6. The second chamber 6 including the glass plate 9 and the semiconductor wafer 7 are disposed on the table 11 of a coordinate stage, which comprises actuators 12 configured and arranged to move the semiconductor wafer 7 parallel and perpendicular to the image plane 13.

To increase resolution, immersion liquid 14 is disposed between the glass plates 5 and 9 which form the boundaries of chambers 2 and 6. The surface 15 of the immersion liquid 14 in a container 16 is higher than the glass plate's 5 surface 17 which faces the semiconductor wafer 7. Consequently, the optical path between the projection lens interface 4 and the photo-sensitive layer 8 on the semiconductor wafer 7 only passes through media with approximately the same refractive index as the photo-sensitive layer 8, assuming that the refractive indexes of the immersion liquids 3, 10 and 14 approximately match. The moving volume of immersion liquid 14, and thus the amount of turbulences in this liquid 14, may be reduced by minimizing, in the design, the distance between the two mutually movable chambers 1 and 6.

As depicted in figure 2, it may be advantageous to modify the chamber 2 such that a glass plate 18 is movable perpendicular to the image plane 13 by means of an annular membrane 19. The film 20 in figure 3 fulfills a similar purpose. In these cases, the chamber 2 is provided with a connection 21 to an apparatus 22 for changing the pressure of the immersion liquid 3.

During exposure of the photo-sensitive layer 8, the glass plate 18 is moved in the direction of the image plane 13 by an increased pressure in the chamber 2. During the movement of the table 11, damage to the glass plate 18 or film 20 is avoided by reducing the pressure of the immersion liquid 3 in the chamber 2 - this moves the glass plate 18 or film 20 away from the moving glass plate 9.

The apparatus from the embodiment may also be employed without immersion liquid 14. In this case, there will be no turbulence problems. The apparatus retains the advantages of the invention, because the afstand between chambers 2 and 6 can be kept to a minimum, and the surfaces sensitive to contamination (including dust) lie outside the Depth-Of-Focus of the projection lens 1.

### Claims

1. Apparatus for photo-lithographic structure transfer by means of:

a projection lens 1 to produce an exposure pattern in a photo-sensitive layer 8 on a substrate 7, wherein the substrate 7 is movable in steps parallel to the image plane 13 and wherein the substrate 7 is exchangeable, whereby an immersion liquid 3,10,14 with a refractive index approximately equal to that of the photo-sensitive layer 8 is disposed in the optical path between the photo-sensitive layer 8 and the projection lens interface 4 facing said layer 8, characterized in that:

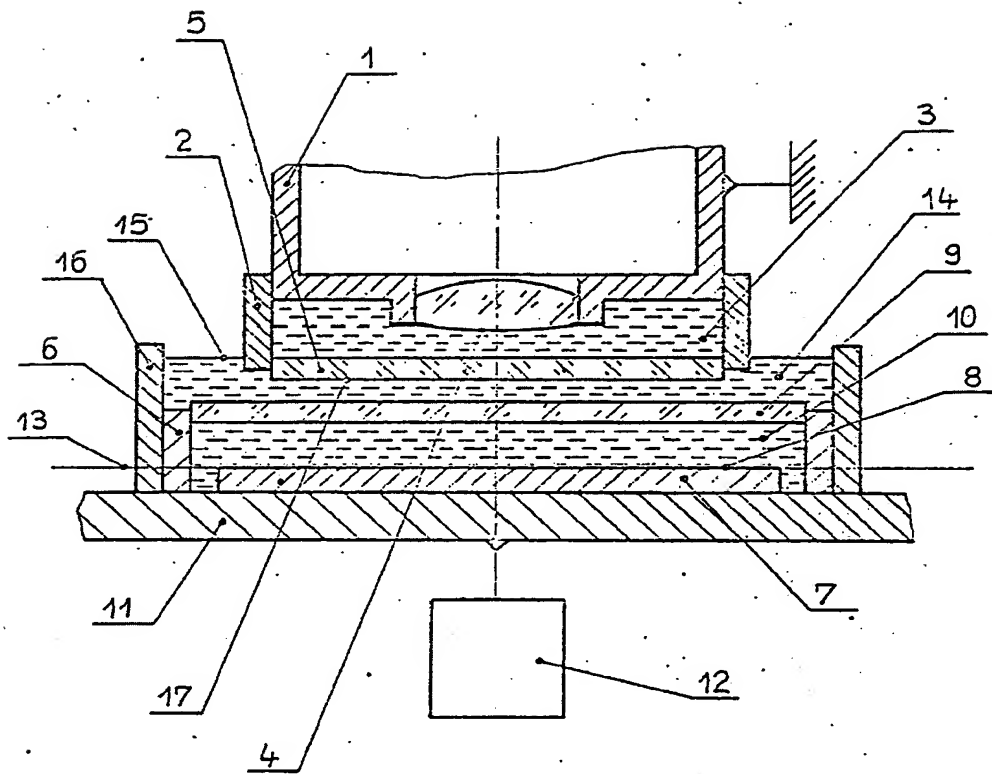
the apparatus further comprises two chambers 2,6, separated from each other and movable with respect to each other, sealed from the atmosphere and filled with immersion liquid 3,10, wherein the chambers 2,6 are disposed in the optical path between the projection lens 1 and the photo-sensitive layer 8 of the substrate 7;

whereby the first chamber 3, which is rigidly attached to the projection lens 1, is bounded by the projection lens interface 4 facing the photosensitive layer 8 and by an optically transparent medium 5; and

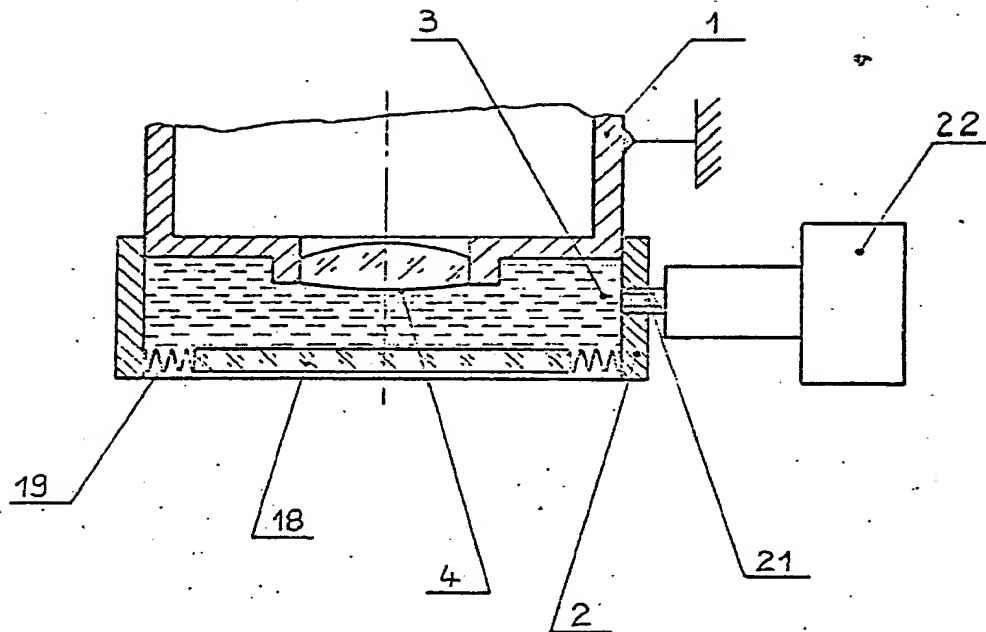
whereby the second chamber 6, which is rigidly attached to the substrate 7, is bounded by the photo-sensitive layer 8 on the substrate 7 and by a further optically transparent medium 9.

2. Apparatus according to claim 1, characterised in that the optically transparent media 5,9 are glass plates and/or films 20.
3. Apparatus according to claims 1 and 2, characterised in that at least one chamber 2,6 is provided with a device for changing the pressure of the immersion liquid, and in that the optically transparent medium 5,10,20 of at least one chamber 2,6 is movable perpendicular to the image plane 13.
4. Apparatus according to claims 1 to 3, characterised in that immersion liquid 14 is also disposed between the optically transparent media 5,9,20 which bound the chambers 2,6.

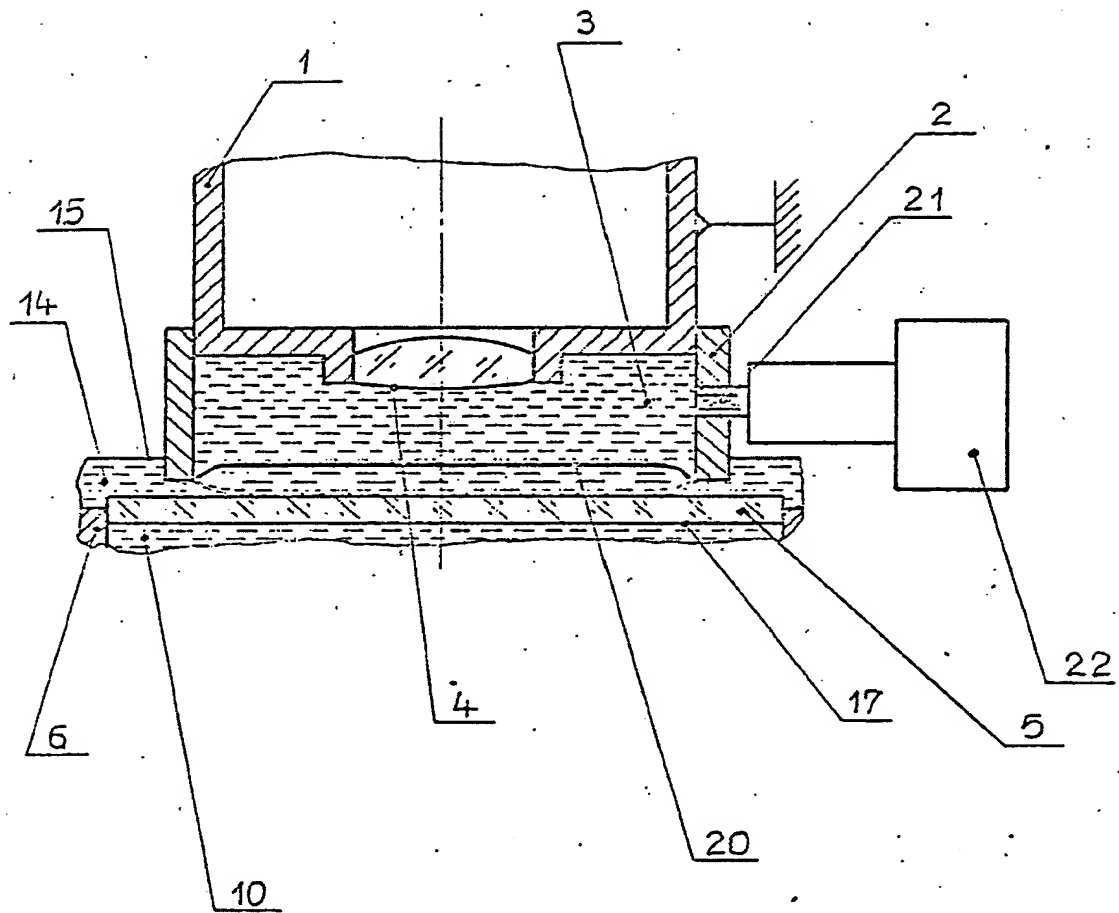
Attached are 3 pages of drawings.



Figur 1



Figur 2



Figur 3